



(11) **EP 3 012 858 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
H01L 21/677 (2006.01) H01L 21/67 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
27.09.2017 Patentblatt 2017/39

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
09.08.2017 Patentblatt 2017/32

(21) Anmeldenummer: **14003620.3**

(22) Anmeldetag: **24.10.2014**

(54) **Prozesskammeranordnung und Verfahren zum Bestrahlen eines Substrats in einer Prozesskammer**

Process chamber assembly and method for irradiating a substrate in a process chamber

Système de chambre de traitement et procédé de rayonnement d'un substrat dans une chambre de traitement

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.04.2016 Patentblatt 2016/17

(73) Patentinhaber: **Von Ardenne GmbH**
01328 Dresden (DE)

(72) Erfinder:
• **Haasemann, Georg**
01326 Dresden (DE)

• **Khvostikova, Olga**
01159 Dresden (DE)

(74) Vertreter: **Viering, Jentschura & Partner mbB**
Patent- und Rechtsanwälte
Am Brauhaus 8
01099 Dresden (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-B3-102013 104 577 JP-A- 2005 026 354
US-A1- 2009 181 184

EP 3 012 858 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).
